```
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat
(c) 2003 EPO. All rts. reserv.
Basic Patent (No, Kind, Date): EP 609860 A2 19940810 <No. of Patents: 013>
Patent Family:
                Kind Date
                                Applic No
                                            Kind Date
    Patent No
                 E 19980615
                                  EP 94101556
                                                  Α
                                                      19940202
   AT 166836
   CN 1104585
                   Α
                       19950705
                                   CN 94102753
                                                  Α
                                                       19940202
                                                       19940202
                                   CN 94102753
   CN 1080645
                   В
                       20020313
                                                  A
                   CO 19980709
                                  DE 69410648
                                                  Α
                                                      19940202
   DE 69410648
                                  DE 69410648
                                                  A
                  T2 19981210
   DE 69410648
                                                      19940202
                                 EP 94101556
                   A2 19940810
                                                 A 19940202
                                                                (BASIC)
   EP 609860
                   A3 19950816 EP 94101556
                                                 A 19940202
   EP 609860
                  B1 19980603 EP 94101556
   EP 609860
                                                 A 19940202
                                                 EP 19940202
   ES 2116478
                  T3 19980716 ES 94101556
                  A2 19941011 JP 9410078
                                                 A 19940131
   JP 6286149
                  B2 20010307 JP 9410078
    JP 3143307
                                                 A 19940131
                  B1 19981201 KR 941857
A 19951226 US 392686
                                                 A 19940202
    KR 152452
                                                 A 19950223
    US 5478606
Priority Data (No, Kind, Date):
    JP 9316238 A 19930203
JP 9410078 A 19940131
    US 392686 A 19950223
    US 190464 B1 19940202
PATENT FAMILY:
AUSTRIA (AT)
  Patent (No, Kind, Date): AT 166836 E
                                        19980615
    HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER EINEN TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSKOPF (German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
      GENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI (JP); SATO TAMAKI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 9316238 A
                                                19930203; JP 9410078 A
      19940131
    Applic (No, Kind, Date): EP 94101556 A
Addnl Info: 00609860 19980603
                                            19940202
    IPC: * B41J-002/16
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q
    Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
    Language of Document: German
AUSTRIA (AT)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
                          19980615 AT REF
                                                 CORRESPONDS TO EP-PATENT
    AT 166836
                      R
                              (ENTSPRICHT EP-PATENT)
                             EP 609860 P
                                            19980603
    AT 166836
                     R
                          19981215
                                    AT RER
                                                  CEASED AS TO PARAGRAPH 5
                                    3 LAW INTRODUCING PATENT TREATIES
                              LIT.
                              (ERLOSCHEN GEM. PAR. 5 ABS. 3 PATVEG.)
CHINA (CN)
  Patent (No, Kind, Date): CN 1104585 A
                                         19950705
    METHOD OF MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD (English)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
      GENJI (JP)
                               JP 9316238
                                                 19930203; JP 9410078 A
    Priority (No, Kind, Date):
                                             Α
      19940131
    Applic (No, Kind, Date): CN 94102753 A
                                            19940202
```

a.,

```
IPC: * B41J-002/16; B41J-002/015; G01D-015/18
    Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
    Language of Document: Chinese
  Patent (No, Kind, Date): CN 1080645 B
                                          20020313
    METHOD FOR MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD (English)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
                          OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
    Author (Inventor):
    GENJI (JP)
Priority (No, Kind, Date):
                                JP 9316238
                                             A
                                                  19930203; JP 9410078 A
      19940131
    Applic (No, Kind, Date): CN 94102753 A
                                             19940202
    IPC: * B41J-002/16; B41J-020/15; G01D-015/18
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q
    Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
    Language of Document: Chinese
GERMANY (DE)
  Patent (No, Kind, Date): DE 69410648 CO 19980709
    HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER EINEN TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSKOPF (German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
      GENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI (JP); SATO TAMAKI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 9316238 A 19930203; JP 9410078 A
      19940131
    Applic (No, Kind, Date): DE 69410648 A
    IPC: * B41J-002/16
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
Language of Document: German
  Patent (No, Kind, Date): DE 69410648 T2 19981210
    HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER EINEN TINTENSTRAHLAUFZEICHNUNGSKOPF (German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): OKUMA NORIO
                                     (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
      GENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI (JP); SATO TAMAKI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 9316238 A 19930203; JP 9410078 A
      19940131
    Applic (No, Kind, Date): DE 69410648 A
                                             19940202
    IPC: * B41J-002/16
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
Language of Document: German
GERMANY (DE)
 Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
    DE 69410648
                P 19980709 DE REF
                                              CORRESPONDS TO (ENTSPRICHT)
                              EP 609860 P
                                             19980709
   DE 69410648
                    P
                        19981210 DE 8373
                                               TRANSLATION OF PATENT
                              DOCUMENT OF EUROPEAN PATENT WAS RECEIVED AND
                              HAS BEEN PUBLISHED (UEBERSETZUNG DER
                              PATENTSCHRIFT DES EUROPAEISCHEN PATENTES IST
                              EINGEGANGEN UND VEROEFFENTLICHT WORDEN)
   DE 69410648
                        19990701 DE 8364
                                               NO OPPOSITION DURING TERM OF
                              OPPOSITION (EINSPRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE
                             DASS EINSPRUCH ERHOBEN WURDE)
EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)
 Patent (No, Kind, Date): EP 609860 A2 19940810
   METHOD OF MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD. (English; French;
     German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
```

```
Author (Inventor): OKUMA NORIO C O CANON KABUSHIK (JP); MIYAGAWA
      MASASHI C O CANON KAB (JP); INADA GENJI C O CANON KABUSHIK (JP);
      TOSHIMA HIROAKI C O CANON KABU (JP); SATO TAMAKI C O CANON KABUSHIK
       (JP)
   Priority (No, Kind, Date):
                              JP 9410078
                                            Α
                                                19940131; JP 9316238 A
     19930203
   Applic (No, Kind, Date): EP 94101556 A
                                           19940202
   Designated States: (National) AT; BE; CH; DE; DK; ES; FR; GB; GR; IE;
     IT; LI; LU; NL; PT; SE
   IPC: * B41J-002/16
   CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736; C 94-250736
   Language of Document: English
 Patent (No, Kind, Date): EP 609860 A3 19950816
   METHOD OF MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD. (English; French;
     German)
   Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): OKUMA NORIO C O CANON KABUSHIK (JP); MIYAGAWA
      MASASHI C O CANON KAB (JP); INADA GENJI C O CANON KABUSHIK (JP);
      TOSHIMA HIROAKI C O CANON KABU (JP); SATO TAMAKI C O CANON KABUSHIK
       (JP)
   Priority
             (No, Kind, Date):
                              JP 9410078
                                            A
                                                19940131; JP 9316238 A
     19930203
   Applic (No, Kind, Date): EP 94101556 A 19940202
   Designated States: (National) AT; BE; CH; DE; DK; ES; FR; GB; GR; IE;
     IT; LI; LU; NL; PT; SE
   IPC: * B41J-002/16
   CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
   Language of Document: English
 Patent (No, Kind, Date): EP 609860 B1 19980603
   METHOD OF MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD (English; French;
     German)
   Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
     GENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI
                                  (JP); SATO TAMAKI (JP)
   Priority (No, Kind, Date): JP 9410078
                                           A 19940131; JP 9316238 A
     19930203
   Applic (No, Kind, Date): EP 94101556 A 19940202
   Designated States: (National) AT; BE; CH; DE; DK; ES; FR; GB; GR; IE;
     IT; LI; LU; NL; PT; SE
    IPC: * B41J-002/16
   CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
   Language of Document: English
EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)
 Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
                     19930203 EP AA
                                             PRIORITY (PATENT
   EP 609860
                   P
                             APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
                             JP 9316238 A
                                            19930203
                   P
                       19940131 EP AA
                                             PRIORITY (PATENT
   EP 609860
                             APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
                             JP 9410078 A
                                            19940131
   EP 609860
                       19940202 EP AE
                                             EP-APPLICATION
                             (EUROPAEISCHE ANMELDUNG)
                             EP 94101556 A
                                             19940202
                       19940810 EP AK
                                             DESIGNATED CONTRACTING
   EP 609860
                   ₽
                             STATES IN AN APPLICATION WITHOUT SEARCH
```

REPORT (IN EINER ANMELDUNG OHNE RECHERCHENBERICHT BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)

			AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE
EP 6	09860	P	19940810 EP A2 PUBLICATION OF APPLICATION WITHOUT SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER ANMELDUNG OHNE RECHERCHENBERICHT)
EP 6	09860	P	19950816 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES IN A SEARCH REPORT (IN EINEM RECHERCHENBERICHT BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)
			AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE
EP 6	09860	P	
EP 6	09860	P	19960306 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT) 960102
EP 6	09860	P	19960417 EP 17Q FIRST EXAMINATION REPORT (ERSTER PRUEFUNGSBESCHEID) 960301
EP 6	09860	P	19980603 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES MENTIONED IN A PATENT SPECIFICATION: (IN EINER PATENTSCHRIFT ANGEFUEHRTE BENANNTE
			VERTRAGSSTAATEN) AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT
EP 6	09860	P	SE 19980603 EP B1 PATENT SPECIFICATION (PATENTSCHRIFT)
EP 6	09860	P	19980603 EP REF IN AUSTRIA REGISTERED AS: (IN AT EINGETRAGEN ALS:) AT 166836 R 19980615
EP 6	09860	P	19980615 CH EP/REG ENTRY IN THE NATIONAL PHASE (EINTRITT IN DIE NATIONALE PHASE)
EP 6	09860	P	19980701 EP ITF IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED (IT: DEPOSITO TRADUZIONE DI BREVETTO EUROPEO) SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.
EP 6	09860	P	19980709 EP REF CORRESPONDS TO: (ENTSPRICHT)
EP 6	09860	P	DE 69410648 P 19980709 19980716 ES FG2A/REG DEFINITIVE PROTECTION (PROTECCION DEFINITIVA)
EP 6	09860	P	2116478T3 19980814 EP ET FR: TRANSLATION FILED (FR: TRADUCTION A ETE REMISE)
EP 6	09860	P	19980826 IE FG4D/REG EUROPEAN PATENTS GRANTED DESIGNATING IRELAND
EP 6	09860	P	19981215 CH PL/REG PATENT CEASED (LOESCHUNG/RADIATION/RADIAZION)
EP 6	09860	P	19990113 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) SE 980903
EP 6	09860		19990526 EP 26N NO OPPOSITION FILED (KEIN EINSPRUCH EINGELEGT)
EP 6	09860	P	19990602 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 980603

EP	609860	P	19990602 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 980603 19990707 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 980603 19990707 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P
			(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 980603
EP	609860	P	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 980603
EP	609860	P	19990811 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 980603
EP	609860	P	
EP	609860	Þ	19990811 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 980603 19990811 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
			AT 980603
	609860	P	19991201 IE MM4A/REG PATENT LAPSED 20000426 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P
			(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603
EP	609860	P	
EP	609860	P	20000426 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603
EP	609860	P	20000426 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 19980603 20000426 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 19980603 20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 19980603 20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 19980603 20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP	609860	P	AT 19980603 20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P
EP	609860	P	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603 20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P
			(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603
EP	609860	, P	20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603

EP 60	9860	P	20000705 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)		
EP 60	9860	P	AT 19980603 20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P		
		_	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60	9860	P	20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60	9860	P	20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)		
EP 60	9860	P	AT 19980603 20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P		
		_	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60	9860	P	20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60	9860	P	20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)		
EP 60:	9860	p	AT 19980603 20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P		
			(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60:	9860	P	20010606 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19980603		
EP 60	9860	P	20020101 GB IF02/REG EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01		
CDAIN /PC	1				
METOD	(No, Kind, Da D PARA LA	FABR	ES 2116478 T3 19980716 RICACION DE UN CABEZAL PARA IMPRESION POR CHORROS DE		
	TA. (Spanis t Assignee:		NON KK		
Author	r (Invento	r):	OKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA MA HIROAKI (JP); SATO TAMAKI (JP)		
Priority (No, Kind, Date): JP 9316238 A 19930203; JP 9410078 A 19940131					
Applic (No,Kind,Date): ES 94101556 EP 19940202 Addnl Info: 0609860 EP patent valid in AT					
	* B41J-002	•	24/24/1702020		
			.24(14)178293Q * C 94-250736		
			: Spanish		
SPAIN (ES) Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):					
ES 2116478 P 19980716 ES FG2A DEFINITIVE PROTECTION (PROTECCION DEFINITIVA) 609860					
JAPAN (JP)					
Patent (No,Kind,Date): JP 6286149 A2 19941011 PRODUCTION OF INK JET RECORDING HEAD (English) Patent Assignee: CANON KK					
Author (Inventor): OKUMA NORIO; SATO KANKI; MIYAGAWA MASASHI; INADA GENJI; TOSHIMA HIROAKI					
Priori 1993	ity (No,Ki: 30203	nd,D	ate): JP 9410078 A 19940131; JP 9316238 A		
Applia	(No.Kind.	Date): JP 9410078 A 19940131		

Applic (No, Kind, Date): JP 9410078 A 19940131

```
IPC: * B41J-002/16
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
   Language of Document: Japanese
  Patent (No, Kind, Date): JP 3143307 B2 20010307
   Priority (No, Kind, Date): JP 9410078 A
                                                19940131; JP 9316238 A
     19930203
   Applic (No, Kind, Date): JP 9410078 A 19940131
   IPC: * B41J-002/16
   CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
Language of Document: Japanese
KOREA, REPUBLIC (KR)
  Patent (No, Kind, Date): KR 152452 B1 19981201
   MANUFACTURING METHOD OF INK JET RECORDING HEAD (English)
   Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor):
                        OKUMA NORIO (JP); MIYAKAWA MASASHI (JP); INADA
     KENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI (JP); SATO DAMAKI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 9316238 A 19930203; JP 9410078 A
     19940131
   Applic (No, Kind, Date): KR 941857 A
                                         19940202
    IPC: * B41J-002/07; B41J-002/16
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q
   Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
   Language of Document: Korean
UNITED STATES OF AMERICA (US)
  Patent (No, Kind, Date): US 5478606 A 19951226
    METHOD OF MANUFACTURING INK JET RECORDING HEAD (English)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): OHKUMA NORIO (JP); MIYAGAWA MASASHI (JP); INADA
      GENJI (JP); TOSHIMA HIROAKI (JP); SATO TAMAKI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): US 392686 A 19950223; JP 9316238 A
      19930203; JP 9410078 A 19940131; US 190464 B1 19940202
   Applic (No, Kind, Date): US 392686 A 19950223
    National Class: * 427555000; 216027000; 216041000; 216067000;
      347020000; 347045000; 427240000; 427386000; 430286000; 430320000;
      430324000
    IPC: * B05D-003/06; B44C-001/22
    CA Abstract No: * 124(14)178293Q; 124(14)178293Q
    Derwent WPI Acc No: * C 94-250736
   Language of Document: English
UNITED STATES OF AMERICA (US)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
                       19930203 US AA
                                             PRIORITY (PATENT)
    US 5478606
                   P
                             JP 9316238 A 19930203
   US 5478606
                       19940131 US AA
                                             PRIORITY (PATENT)
                             JP 9410078 A
                                             19940131
                       19940202 US AA
   US 5478606
                   Ρ
                                             PRIORITY
                             US 190464 B1 19940202
   US 5478606
                   P
                       19950223 US AE
                                              APPLICATION DATA (PATENT)
                             (APPL. DATA (PATENT))
                             US 392686 A 19950223
                                            PATENT
                       19951226 US A PATENT
19960604 US CC CERTIFICATE OF CORRECTION
    US 5478606
                   P
                   P
   US 5478606
```

•

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
,			

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許書号

特許第3143307号 (P3143307)

(45)発行日 平成13年3月7日(2001.3.7)

(24) 登録日 平成12年12月22日(2000.12.22)

(51) Int.CL'

識別記号

B41J 2/16

FΙ

B41J 3/04

103H

請求項の数13(全 8 頁)

(21)出職番号	特職平6-10078	(73)特許権者	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成6年1月31日(1994.1.31)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	大麒 美夫
(65)公園番号	特男平6-286149	[東京都大田区下丸子3丁目30書2号 キ
(43)公開日	平成6年10月11日(1994.10.11)		ヤノン株式会社内
審查請求日	平成10年6月19日(1998.6.19)	(72)発明者	佐藤 環樹
(31)優先權主張番号	特膜平5 -16238		東京都大田区下丸子3丁目30書2号 キ
(32) 優先日	平成5年2月3日(1993.2.3)		ヤノン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72) 発明者	宮川 昌士
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
			ヤノン株式会社内
		(74)代理人	100077481
			弁理士 谷 義一 (外1名)
		審査官	甩椅 俊彦
			幾件頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェット配録ヘッドの製造方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 インク吐出圧力発生素子が形成された基 体上に、

- (i)溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成す る工程と、
- (ii) 常温にて固体状のエポキシ樹脂を主成分とする被 **覆樹脂を溶媒に該被覆樹脂の溶液中の濃度が30~70** wt%となるように溶解し、これを前記溶解可能な樹脂 層上にソルベントコートすることによって、前記溶解可 能な樹脂層上にインク流路壁となる被覆樹脂層を形成す 10 ンクジェット記録ヘッドの製造方法。 る工程と、
- (iii) 前記インク吐出圧力発生素子上方の前記被預樹 脂層にインク吐出口を形成する工程と、
- (iv) 前記溶解可能な樹脂層を溶出する工程と、 を有することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの

2

製造方法。

【請求項2】 前記被覆樹脂が、感光性樹脂であり、光 カチオン重合開始剤を含有することを特徴とする請求項 1に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項3】 前記被覆樹脂が還元剤を含有することを 特徴とする請求項2に記載のインクジェット記録ヘッド の製造方法。

【請求項4】 前記光カチオン重合開始剤が芳香族ヨウ ドニウム塩であることを特徴とする請求項2に記載のイ

【請求項5】 前記還元剤が網トリフラートであること を特徴とする請求項3に記載のインクジェット記録へッ ドの製造方法。

【請求項6】 前記エポキシ樹脂のエポキシ当量が20 00以下であることを特徴とする請求項1に記載のイン クジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項7】 前記溶解可能な樹脂層を溶出する工程の 後に、前記被罪樹脂を還元剤を含有する溶液に浸漬して 加熱する工程を有することを特徴とする請求項1に記載 のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項8】 前記還元剤が銅イオンを含有することを 特徴とする請求項7に記載のインクジェット記録ヘッド の製造方法。

【請求項9】 前記還元剤が銅トリフラートを含有する ヘッドの製造方法。

【請求項10】 前記インク吐出口がフォトリソグラフ ィーによって形成されることを特徴とする請求項2に記 載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項11】 前記インク吐出口が酸素アラズマによ るドライエッチングによって形成されることを特徴とす る請求項1に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方

【請求項12】 前記インク吐出口がエキシマレーザー によって形成されることを特徴とする請求項1に記載の 20 インクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項13】 前記溶媒に溶解された被精樹脂の溶液 中の濃度を40~60wt%とすることを特徴とする請 求項1に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインクジェット記録方式 に用いる記録液小滴を発生するためのインクジェット記 録ヘッドの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式(液体噴射記録 方式) に適用されるインクジェット記録ヘッドは、一般 に微細な記録液吐出口(以下、オリフィスと称す)、液 流路および該液流路の一部に設けられる液体吐出エネル ギー発生部を複数備えている。そして、このようなイン クジェット記録ヘッドで高品位の画像を得るためには、 前記オリフィスから吐出される記録液小滴がそれぞれの 吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが 望ましい。これを達成するために、特開平4-1094 0号~特開平4-10942号公報においては、インク 吐出圧力発生素子 (電気熱変換素子) に記録情報に対応 して駆動信号を印加し、電気熱変換素子にインクの核沸 騰を越える急激な温度上昇を与える熱エネルギーを発生 させ、インク内に気泡を形成させ、この気泡を外気と連 通させてインク液滴を吐出させる方法が開示されてい

【0003】このような方法を実現するためのインクジ ェット記録ヘッドとしては、電気熱変換素子とオリフィ スとの距離(以下、「OH距離」と称す。)が短い方が 好ましい。また、前記方法においては、OH距離がその 50 【0008】

吐出体積をほぼ決定するため、OH距離を正確に、また 再現良く設定できることが必要である。

【0004】従来、インクジェット記録ヘッドの製造方 法としては、特開昭57~208255号公報へ特開昭 57-208256号公報に記載されている方法、すな わち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上にイ ンク流路およびオリフィス部からなるノズルを感光性樹 脂材料を使用してパターン形成して、この上にガラス板 などの蓋を接合する方法や、特開昭61-154947 ことを特徴とする請求項7に記載のインクジェット記録 10 号公報に記載されている方法、すなわち、溶解可能な樹 脂にてインク流路パターンを形成し、該パターンをエボ キシ樹脂などで被覆して該樹脂を硬化し、基板を切断後 に前記溶解可能な樹脂パターンを溶出除去する方法等が ある。しかし、これらの方法は、いずれも気泡の成長方 向と吐出方向とが異なる(ほぼ垂直)タイプのインクジ ェット記録ヘッドの製造方法である。そして、このタイ プのヘッドにおいては、基板を切断することによりイン ク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離が設定される ため、インク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離の 制御においては、切断精度が非常に重要なファクターと なる。しかしながら、切断はダイシングソー等の機械的 手段にて行うことが一般的であり、高い精度を実現する ことは難しい。

> 【0005】また、気泡の成長方向と吐出方向とがほぼ 同じタイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法とし ては、特開昭58-8658号公報に記載されている方 法、すなわち、基体とオリフィスプレートとなるドライ フィルムとをパターニングされた別のドライフィルムを 介して接合し、フォトリソグラフィーによってオリフィ 30 スを形成する方法や、特開昭62-264975号公報 に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生 素子が形成された基体と電鏡加工により製造されるオリ フィスプレートとをパターニングされたドライフィルム を介して接合する方法等がある。しかし、これらの方法 では、いずれもオリフィスプレートを薄く (例えば20 µm以下)かつ均一に作成することは困難であり、たと え作成できたとしても、インク吐出圧力発生素子が形成 された基体との接合工程はオリフィスプレートの脆弱性 により極めて困難となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の諸点 に鑑み成されたものであって、インク吐出圧力発生素子 とオリフィス間の距離を極めて高い精度で短くかつ再現 よく設定可能で、高品位記録が可能なインクジェット記 録ヘッドの製造方法を提供することを目的とする。

【0007】さらに本発明の別な目的は、製造工程を短 縮化することができ、安価で信頼性の高いインクジェッ ト記録ヘッドを得ることのできるインクジェット記録へ ッドの製造方法を提供することにある。

5

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の形態は、インク吐出圧力発生素子が形成された基体 上に、(i)溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを 形成する工程と、(li)常温にて固体状のエポキシ樹脂 を主成分とする被覆樹脂を溶媒に該被覆樹脂の溶液中の 濃度が30~70wt%となるように溶解し、これを前 記溶解可能な樹脂層上にソルベントコートすることによ って、前記溶解可能な樹脂層上にインク流路壁となる被 覆樹脂層を形成する工程と、(iii)前記インク吐出圧 力発生素子上方の前記被覆樹脂層にインク吐出口を形成 10 口と同じ面に設けてもよい、 する工程と、(iv)前記溶解可能な樹脂層を溶出する工 程と、を有することを特徴とするインクジェット記録へ ッドの製造方法である。

[0009]

【作用】本発明によれば、インク吐出圧力発生素子とオ リフィス間の距離を極めて高い精度で短くかつ再現よく 設定可能で、高品位記録が可能なインクジェット記録へ ッドの製造方法を提供することができるものである。 [0010]

【実施例】以下、図面を参照しつつ本発明を詳細に説明 20 する.

【0011】図1から図6は、本発明の基本的な態様を 示すための模式図であり、図1から図6のそれぞれに は、本発明の方法に係わるインクジェット記録ヘッドの 構成とその製作手順の一例が示されている。

【0012】まず、本態様においては、例えば図1に示 されるような、ガラス、セラミックス、プラスチックあ るいは金属等からなる基板1が用いられる。

【0013】このような基板1は、液流路構成部材の一 部として機能し、また、後述のインク流路およびインク 30 可能であるためである。 吐出口を形成する材料層の支持体として機能し得るもの であれば、その形状、材質等に特に限定されることなく 使用できる。上記基板1上には、電気熱変換素子あるい は圧電素子等のインク吐出エネルギー発生素子2が所望 の個数配置される。このような、インク吐出エネルギー 発生素子2によって記録液小滴を吐出させるための吐出 エネルギーがインク液に与えられ、記録が行われる。ち なみに、例えば、上記インク吐出エネルギー発生素子2 として電気熱変換素子が用いられる時には、この素子が 近傍の記録液を加熱することにより、記録液に状態変化 40 を生起させ吐出エネルギーを発生する。また、例えば、 圧電素子が用いられる時は、この素子の機械的振動によ って、吐出エネルギーが発生される。

【0014】なお、これらの素子2には、これら素子を 動作させるための制御信号入力用電極(図示せず)が接 続されている。また、一般にはこれら吐出エネルギー発 生素子の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機 能層が設けられるが、もちろん本発明においてもこのよ うな機能層を設けることは一向に差し支えない。

3を基板1上に予め設けておき、基板後方よりインクを 供給する形態を例示した。該開口部3の形成において は、基板1に穴を形成できる手段であれば、いずれの方 法も使用できる。例えば、ドリル等機械的手段にて形成 しても構わないし、レーザー等の光エネルギーを使用し ても構わない。 また、 基板 1 にレジストパターン等を形 成して化学的にエッチングしても構わない。

【0016】もちろん、インク供給口を基板1に形成せ ず、樹脂パターンに形成し、基板1に対してインク吐出

【0017】次いで、図2 (図1のA-A・断面図) に 示すように、上記インク吐出エネルギー発生素子2を含 む基板1上に、溶解可能な樹脂にてインク流路パターン 4を形成する。最も一般的な手段としては感光性材料に て形成する手段が挙げられるが、スクリーン印刷法等の 手段にても形成は可能である。感光性材料を使用する場 合においては、インク流路パターンが溶解可能であるた め、ポジ型レジストか、あるいは溶解性変化型のネガ型 レジストの使用が可能である。

【0018】レジスト層の形成の方法としては、基板上 にインク供給口を設けた基板を使用する場合には、該感 光性材料を適当な溶剤に溶解し、PETなどのフィルム 上に塗布、乾燥してドライフィルムを作成し、ラミネー トによって形成することが好ましい。上述のドライフィ ルムとしては、ポリメチルイソプロピルケトン、ポリビ ニルケトン等のビニルケトン系光崩壊性高分子化合物を 好適に用いることができる。というのは、これら化合物 は、光照射前は高分子化合物としての特性(被膜性)を 維持しており、インク供給口3上にも容易にラミネート

【0019】また、インク供給口3に後工程で除去可能 な充填物を配置し通常のスピンコート法、ロールコート 法等で被膜を形成しても構わない。

【0020】このように、インク流路をパターニングし た溶解可能な樹脂材料層4上に、図3に示すように、さ らに被覆樹脂層5を通常のスピンコート法、ロールコー ト法等で形成する。ここで、該樹脂層5を形成する工程 において、溶解可能な樹脂パターンを変形せしめない等 の特性が必要となる。すなわち、被覆樹脂層うを溶剤に 溶解し、これをスピンコート、ロールコート等で溶解可 能な樹脂パターン4上に形成する場合、溶解可能な樹脂 バターン4を溶解しないように溶剤を選択する必要があ

【0021】次に、本発明に用いる被覆樹脂層5につい て説明する。被覆樹脂層5としては、インク吐出口3を フォトリソグラフィーで容易にかつ精度よく形成できる ことから、感光性のものが好ましい。このような感光性 板1との密着性、耐インク性と、同時にインク吐出口の 【0015】図1において、インク供給のための開口部 50 微細なパターンをパターニングするための解像性が要求

される。ここで、本願発明者は、鋭意検討の結果、エボ キシ樹脂のカチオン重合硬化物が構造材料として優れた 強度、密着性、耐インク性を有し、かつ前記エポキシ樹 脂が常温にて固体状であれば、優れたパターニング特性 を有することを見出し、本発明に至った。

【0022】まず、エボキシ樹脂のカチオン重合硬化物 は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較 して高い架橋密度(高丁g)を有するため、構造材とし て優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエボキシ 樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤 10 より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中への拡散が抑 えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることがで きる.

【0023】溶解可能な樹脂層上に被覆樹脂層を形成す る工程は、常温で固体状の被覆樹脂を溶剤に溶解し、ス ピンコート法で形成することが望ましい。

【0024】薄膜コーティング技術であるスピンコート 法を用いることで、被覆樹脂層5は均一にかつ精度良く 形成することができ、従来方法では困難であったインク 吐出圧力発生素子2とオリフィス間の距離を短くするこ 20 とができ、小液滴吐出を容易に達成することができる。 【0025】ここで、被覆樹脂層5は溶解可能な樹脂層 4上にフラットに形成されることが望ましい。これは下 記の理由による。

【0026】・オリフィス面に凸凹があると凹部に不要 なインク溜を生じること、

・被覆樹脂層5にインク吐出口を形成する際に加工が容 易であること。

【0027】そこで、本発明者らは、被覆樹脂層5をフ の溶剤に対する濃度が被覆樹脂層5の平滑性の点で非常 に重大なファクターとなっていることを見いだした。具 体的にはスピンコート時に被覆樹脂を溶剤に対して30 ~70wt%の濃度で、さらに好ましくは40~60w **t%の濃度で溶解させることにより被覆樹脂層5表面を** フラットにすることが可能となる。

【0028】ここで、被覆樹脂を30wt%未満の濃度 で溶解し、スピンコートを行った時には、形成された被 覆樹脂層がパターニングされた溶解可能な樹脂層4にな %を越える濃度で溶解した場合には、溶液自体が高粘度 になり、スピンコート不能となるか、例え、スピンコー トできたとしても、その膜厚分布が悪化する。

【0029】そもそもスピンコート法により塗布を行う 場合は、塗布剤の粘度を10~3000cpsとする必 要がある。これは粘度が低過ぎる時には塗布剤が流れ出 してしまい、粘度が高すぎる場合は塗布剤が均等にゆき わたってくれないからである。したがって、被覆樹脂含 有溶液の粘度が上述の濃度において所望の粘度となるよ うに溶剤を適宜選択することが必要である。

【0030】また、被覆樹脂5として上述のいわゆるネ ガ型の感光性材料を用いた場合、通常は基板面からの反 射、およびスカム (現像残渣) が発生する。しかしなが ら、本発明の場合、溶解可能な樹脂にて形成されたイン ク流路上に吐出口パターンを形成するため、基板からの 反射の影響は無視でき、さらに現像時に発生するスカム は、後述のインク流路を形成する溶解可能な樹脂を洗い 出す工程でリフトオフされるため、悪影響を及ぼさな U.

8

【0031】本発明に用いる固体状のエボキシ樹脂とし ては、ビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物 のうち分子量がおよそ900以上のもの、含プロモスフ ェノールAとエピクロヒドリンとの反応物、フェノール ノボラックあるいは0 ークレゾールノボラックとエピク ロヒドリンとの反応物、特開昭60-161973号公 報、特開昭63-221121号公報、特開昭64-9 216号公報、特開平2-140219号公報に記載の オキシシクロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂 等があげられるが、もちろん本発明はこれら化合物に限 定されるわけではない。

【0032】また、上述のエボキシ化合物においては、 好ましくはエポキシ当量が2000以下、さらに好まし くはエポキシ当量が1000以下の化合物が好適に用い られる。これは、エポキシ当量が2000を越えると、 硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のTgもしく は熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題 が生じる場合があるからである。

【0033】上記エボキシ樹脂を硬化させるための光カ チオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩.芳 ラットに形成する条件を鋭意検討したところ、被覆樹脂 30 香族スルホニウム塩[J. POLYMER SCI:S ymposium No. 56 383-395 (197 6)参照]や旭電化工業株式会社より上市されているS P-150、SP-170等が挙げられる。

【0034】また、上述の光カチオン重合開始剤は、還 元剤を併用し加熱することによって、カチオン重合を促 進(単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上す る。) させることができる。ただし、光カチオン重合開 始剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せず一定温 度以上 (好ましくは60℃以上) で反応するいわゆるレ らって凸凹を生じてしまう。また、被覆樹脂を70wt 40 ドックス型の開始剤系になるように、還元剤を選択する 必要がある。このような還元剤としては、銅化合物、特 に反応性とエポキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフ ラート (トリフルオロメタンスルフォン酸鋼(II))が 最適である。また、アスコルビン酸等の還元剤も有用で ある。また、ノズル数の増加(高速印刷性)、非中性イ ンクの使用 (着色剤の耐水性の改良)等、より高い架橋 密度(高Tg)が必要な場合は、上述の還元剤を後述の ように前記被覆樹脂層の現像工程後に溶液の形で用いて 被覆樹脂層を浸漬および加熱する後工程によって、架橋 50 密度をあげることができる。

【0035】さらに上記組成物に対して必要に応じて添 加剤など適宜添加することが可能である。例えば、エポ キシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加し たり、あるいは基板との更なる密着力を得るためにシラ ンカップリング剤を添加することなどがあげられる。

【0036】次いで、上記化合物からなる感光性被覆樹 脂層5に対して、図4に示すように、マスク6を介して パターン露光を行う。本態様の感光性被覆樹脂層5は、 ネガ型であり、インク吐出口を形成する部分をマスクで 道蔽する(むろん、電気的な接続を行う部分も道蔽す る。図示せず。)。

【0037】パターン露光は、使用する光カチオン重合 開始剤の感光領域に合わせて紫外線、Deep-UV 光、電子線、X線などから適宜選択することができる。 【0038】ここで、これまでの工程は、すべて従来の フォトリソグラフィー技術を用いて位置合わせが可能で あり、オリフィスプレートを別途作成し基板と張り合せ る方法に比べて、格段に精度をあげることができる。こ うしてパターン露光された感光性被覆樹脂層5は、必要 に応じて反応を促進するために、加熱処理を行ってもよ 20 い。ここで、前述のごとく、窓光性被覆樹脂層は常温で 固体状のエボキシ樹脂で構成されているため、パターン 露光で生じるカチオン重合開始種の拡散は制約を受け、 優れたパターニング精度、形状を実現できる。

【0039】次いで、パターン露光された感光性被覆樹 脂層5は、適当な溶剤を用いて現像され、図5に示すよ うに、インク吐出口を形成する。ここで、未露光の感光 性被覆樹脂層の現像時に同時にインク流路を形成する溶 解可能な樹脂パターン4を現像することも可能である。 ただし、一般的に、基板1上には複数の同一または異な 30 カラー記録ヘッドにも有効である。 る形態のヘッドが配置され、切断工程を経てインクジェ ット記録ヘッドとして使用されるため、切断時のごみ対 策として、図5に示すように感光性被覆樹脂層5のみを 選択的に現像することにより、インク流路を形成する樹 脂パターン4を残し(液室内に樹脂パターン4が残存す るため切断時に発生するゴミが入り込まない)、切断工 程後に樹脂パターン4を現像することも可能である(図 6)。また、この際、感光性被覆樹脂層 5 を現像する時 に発生するスカム (現像残渣) は、溶解可能な樹脂層4 と共に溶出されるためノズル内には残渣が残らない。 【0040】前述したように架橋密度を上げる必要があ る場合には、この後、インク流路およびインク吐出口が 形成された感光性被覆樹脂層与を選元剤を含有する溶液 に浸漬および加熱することにより後硬化を行う。これに より、感光性被覆樹脂層5の架橋密度はさらに高まり、 基板に対する密着性および耐インク性は非常に良好とな る。もちろん、この個イオン含有溶液に浸漬加熱する工 程は、窓光性被覆樹脂層5をパターン露光し、現像して インク吐出口を形成した直後に行っても一向にさしつか えなく、その後で溶解可能な樹脂パターン4を溶出して「50 ールドミラーCM290)にてインク流路のパターン露

10 も構わない。また浸漬、加熱工程は、浸漬しつつ加熱し

ても構わないし、浸漬後に加熱処理を行っても構わな

【0041】このような還元剤としては、還元作用を有 する物質であれば有用であるが、特に飼トリフラート。 酢酸銅、安息香酸銅など銅イオンを含有する化合物が有 効である。前記化合物の中でも、特に銅トリフラートは 非常に高い効果を示す、さらに前記以外にアスコルビン 酸し有用である。

【0042】このようにして形成したインク流路および インク吐出口を形成した基板に対して、インク供給のた めの部材7およびインク吐出圧力発生業子を駆動するた めの電気的接合 (図示せず) を行ってインクジェット記 録ヘッドが形成される(図7).

【0043】本実施態様では、インク吐出口の形成をフ ォトリソグラフィーによって行ったが、本発明はこれに 限ることなく、マスクを変えることによって、酸素プラ ズマによるドライエッチングやエキシマレーザーによっ てもインク吐出口を形成することができる。エキシマレ ーザーやドライエッチングによってインク吐出口を形成 する場合には、基板が樹脂パターンで保護されてレーザ ―やプラズマによって傷つくことがないため、精度と信 賴性の高いヘッドを提供することも可能となる。さら に、ドライエッチングやエキシマレーザー等でインク吐 出口を形成する場合は、被覆樹脂層与は感光性のもの以上 外にも熱硬化性のものも適用可能である。

【0044】本発明は、記録紙の全幅にわたり同時に記 録ができるフルラインタイプの記録ヘッドとして、さら には記録ヘッドを一体的にあるいは複数個組み合わせた

【0045】また、本発明による記録ヘッドは、ある温 度以上で液化する固体インクにも好適に適用される。

【0046】(実施例)以下、本発明の実施例を示す。 【0047】·実施例1

本実施例では、前述の図1~図7に示す手順にしたがっ て、インクジェット記録ヘッドを作製した。

【0048】まず、吐出エネルギー発生素子としての電 気熱変換素子2 (材質HfB2 からなるヒーター)を形 成したシリコン基板1上にプラストマスクを設置し、サ 40 ンドブラスト加工によりインク供給のための賃通口3を 形成した(図1).

【0049】次いで、該基板1上に、溶解可能な樹脂層 4としてポリメチルイソプロベニルケトン(東京応化工 業 (株) 社製ODUR-1010) をPET上に塗布、 乾燥しドライフィルムとしたものをラミネートにより転 写した。なお、ODUR-1010は、低粘度であり厚 膜形成できないため濃縮して用いた。

【0050】次いで、120℃にて20分間プリベーク した後、キャノン製マスクアライナーPLA520(コ 光を行った。露光は1.5分間、現像はメチルイソブチ ルナトン/キシレン=2/1、リンスはキシレンを用い た。該溶解可能な樹脂で形成されたパターン4は、イン ク供給口3と電気熱変換業子2とのインク流路を確保す るためのものである(図2)。なお、現像後のレジスト の膜厚は10μmであった。

【0051】次いで、表1に示す樹脂組成物をメチルイ ソブチルケトン/キシレン混合溶媒に50wt%の濃度 で溶解し、スピンコートにて感光性被覆樹脂層5を形成 した。(パターン4上における膜厚10μm 図3)。 10 は、光のみで硬化させたものに比べて架路密度が高く、 【0052】次いで、PLA520(CM250)に て、インク吐出口形成のためのパターン露光を行った (図4)、なお、露光は10秒、アフターベークは60 で 30分間行った。

【0053】次いで、メチルイソブチルケトンで現像を 行い、インク吐出口を形成した。なお、本実施例ではゅ 25μmの吐出口パターンを形成した。

【0054】また、前記条件ではインク流路パターン4 は完全に現像されず残存している。

【0055】通常、基板1上には複数の同一または異な 20 る形状のヘッドが配置されているために、この段階でダ イサー等により切断し、個々のインクジェット記録へッ ドを得るが、ここでは前述の通りにインク流路パターン 4が残存しているため、切断時に発生するゴミがヘッド 内に侵入することを防止できる.こうして得られたイン クジェット記録ヘッドは、再びPLA520 (CM29 0)にて2分間露光し、メチルイソブチルケトン中に超 音波を付与しつつ浸漬し、残存しているインク流路パタ ーン4を溶出した(図6).

50℃ 1時間加熱し感光性被覆材料層 5を完全に硬化

【0057】最後に、図7に示すように、インク供給口 にインク供給部材7を接着してインクジェット記録へッ ドが完成する。

【0058】このようにして作成したインクジェット記 録ヘッドを記録装置に装着し、純水/ジエチレングリコ ール/イソプロピルアルコール/酢酸リチウム/黒色染 料フードブラック2=79.4/15/3/0.1/ 2. 5からなるインクを用いて記録を行ったところ、安 40 定な印字が可能であり、得られた印字物は高品位なもの であった。

【0059】·実施例2

ついで、前記実施例1の感光性被覆樹脂層5を表2に示 す組成に変えて、同様に評価を行なった。本実施例は、 光カチオン重合開始剤と還元剤を併用することでノズル 構成材料(感光性被覆樹脂の硬化物)の機械的強度、基 板1に対する密着性等をより向上させたものである。感 光性被覆樹脂層5の形成までは、実施例1と同様に行な った。インク吐出口のパターン露光は、PLA520

(CM250)で5秒間、アフターベークは60℃ 1 0分間行なった。この条件では、光カチオン重合開始剤

と還元剤 (銅トリフラート) は実質的に反応しないた め、光によるパターニングが可能である。

【0060】ついで、実施例1と同様に現像、切断、イ ンク流路4の洗い出しを行った後に、150℃で1時間 ベーク処理を行った。この段階で光カチオン重合開始剤 と銅トリフラートが反応し、エポキシ樹脂のカチオン重 合を促進する。こうして得られたエポキシ樹脂の硬化物 機械的強度、基板との密着性、耐インク性に優れるもの であった。また、このようにして作成したインクジェッ ト機録ヘッドを記録装置に装着し、実施例1と同様に、 純水/ジエチレングリコール/イソプロピルアルコール /酢酸リチウム/黒色染料フードブラック2-79.4 /15/3/0.1/2.5からなるインクを用いて記 録を行ったところ、安定な印字が可能であり、得られた 印字物は高品位なものであった。

12

【0061】さらに、このインクジェット記録ヘットに 前記インクを充填した状態で、60℃ 3か月保存した 後に、再び印字を行ったところ、保存試験前と同様な印 字物を得ることができた。

【0062】·実施例3

次いで、前記実施例1のインクジェット記録ヘッドを還 元剤を含有する溶液に浸漬、加熱する後工程を行い、同 様に評価を行った、

【0063】実施例1のインク流路4の洗い出し工程の 後に、鍋トリフラートの2wt%エタノール溶液に30 分間超音波を付与しつつ浸漬し、乾燥後、150℃で2 【0056】次いで、インクジェット記録ヘッドを、1 30 時間加熱処理を行い、加熱処理後に純水洗浄を行った。 次いで、実施例1と同様にインク供給口にインク供給部 材7を接着して、インクジェット記録ヘッドが完成す

> 【0064】このようにして作成したインクジェット機 録ヘッドを記録装置に装着し、実施例1と同様に、純水 /ジエチレングリコール/イソプロピルアルコール/酢 酸リチウム/黒色染料フードブラック2=79.4/1 5/3/0.1/2.5からなるインクを用いて記録を 行ったところ、安定な印字が可能であり、得られた印字 物は高品位なものであった。

【0065】ここで、銅イオン浸漬による架橋密度の向 上を確認するために、以下の実験を行った。表1に示す 組成物をカプトンフィルム上に10 m厚で形成し、光 硬化させた後に、銅イオンを含有するエタノール溶液に 浸漬、加熱処理を行ったサンプル(a)と、銅イオンを 含まない純粋なエタノール溶液に浸漬、加熱処理を行っ たサンプル(b)を作製した。これらサンプルのガラス 転移点(Tg)を動的粘弾性評価を用いて測定したとこ ろ、サンプル (a) はTg=240℃、(b) はTg= 50 200℃であった。上記結果より明らかなように、銅イ

14

13 オンによる後処理で架橋密度の向上がなされ、信頼性の 高いインクジェット記録ヘッドを作製することができ

【0066】 【表1】

Z.

エポキシ 樹脂	o-クレソールノホラック型エポキシ樹脂 (油化シェル社製エヒコート180H65)	100 部
光カチオン 重合開始剤	4.4'-ジーセーブテルフェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート	1部
シランカップ リング剤	日本ユニカー社製 A-187	10部

[0067]

※ ※【表2】

エポキシ	tキシシクロヘキサン骨格の多官能 エポキシ樹脂 (ダイセル化学社製EHPE-3150)	100部
光カチオン 重合開始剤	4.4'-ジーセーブチルフェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート	0.5部
還元剤	銅トリフラート	0.5音队
シランカップ リング剤	日本ユニカー社製 A - 187	5部

[0068]

【発明の効果】以上説明した本発明によってもたらされる効果としては、インク吐出圧力発生素子とオリフィス間の距離、位置精度を厳密に制御できるため、吐出特性の安定しかつ信頼性の高いインクジェット記録ヘッドが簡単な手法にて製造できることが挙げられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】インク流路、オリフィス部形成前の基板の模式 的斜視図である。

【図2】溶解可能なインク流路パターンを形成した基板 の模式図である。

【図3】被覆樹脂層を形成した基板の模式図である。

【図4】被覆樹脂層にインク吐出口のパターン露光を行

っている基板の模式図である。

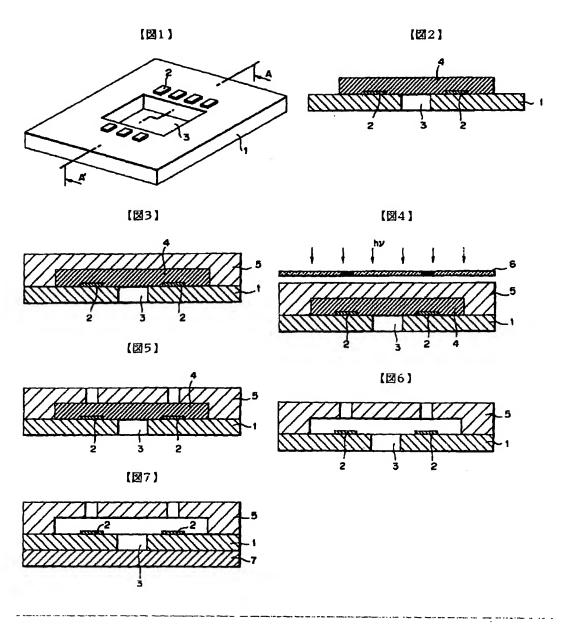
30★【図5】バターニングされた被覆樹脂層を現像した基板 の模式図である。

【図6】溶解可能な樹脂パターンを溶出した基板の模式 図である。

【図7】インク供給部材を配置した基板の模式図であ

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 インク吐出圧力発生素子
- 3 インク供給口
- 40 4 溶解可能な樹脂層で形成されたインク流路
 - 5 被覆樹脂層
 - 6 マスク
 - 7 インク供給部材



フロントページの続き

(72)発明者 稲田 源次

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ

ヤノン株式会社内

(72)発明者 戸島 博彰

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ

ヤノン株式会社内

(56)参考文献 特開 平4-216952 (JP, A)

特開 昭61-154947 (JP, A)

特開 平3-184868 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.7, DB名) B41J 2/16